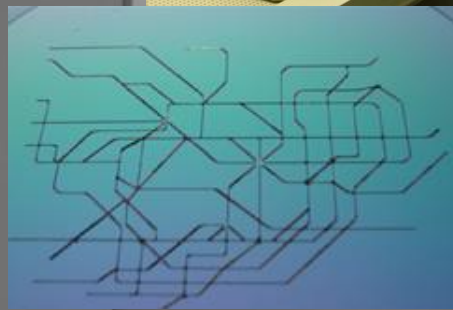


令和3年度 第4回
ナノファブスクエア in 海老名 講習・実習会

シリコン異方性
エッチング



試作する東京地下鉄路線網マイクロ流路チップ。試作後、第16回で陽極接合。



川崎市

初心者
歓迎



日本工学会
ECEプログラム認定

日時

令和3年6月17日(木)
13:30~16:30

場所

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)
海老名本部 (神奈川県海老名市下今泉705-1
小田急線・相鉄線・JR相模線の海老名駅から徒歩15分)

講師

黒内 正仁 (神奈川県立産業技術総合研究所 電子技術部)

実習内容

シリコン熱酸化膜をマスクとしてシリコンの結晶異方性エッチングでマイクロ流路作成の実習を行います。

実習機器

- ・ ドラフト、超純水製造装置

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBI C」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今回は、KISTECの設備・装置を使った実習を行います。

定員：先着5名程度 参加費：11,000円(実費)

※川崎市中小企業に対する、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金の適用はございません。

主催：4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム、(地独)神奈川県立産業技術総合研究所、川崎市

問い合わせ先

(地独)神奈川県立産業技術総合研究所 海老名本部 Tel: 046-236-1500 (代表)

技術担当 三橋 雅彦 電子技術部 /E-mail: mitsu@kistec.jp

事務担当 陶山、津島 人材育成部 /E-mail: sm_sangyoujinzai@kistec.jp